



平成31年度 知的財産権制度活用優良企業等表彰

知財功労賞 経済産業大臣表彰

知財活用ベンチャー

株式会社FLOSFIA

代表取締役社長 人羅 俊実

会社概要

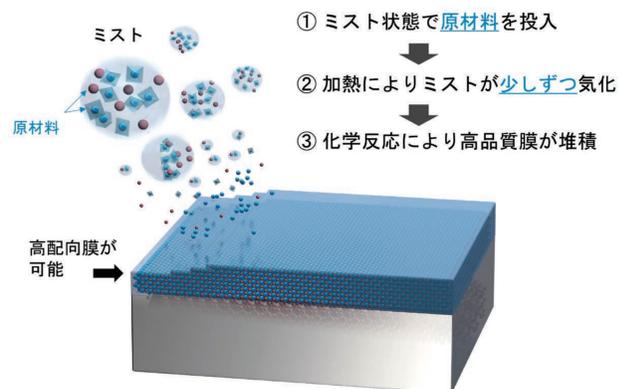
<http://flosfia.com/>

所在地	京都府京都市西京区御陵大原1-29
設立	2011年
資本金	2,710百万円(資本準備金含む)
従業員	50人
事業内容	酸化ガリウムパワーデバイスの開発・製造、独自技術ミストドライによる薄膜の製造



受賞のポイント

- 京都大学発のベンチャー企業であり、世界を一変させる日本発の画期的半導体として注目され、低コスト・小型化・高性能を実現し得る酸化ガリウム系パワーデバイスと、ミストドライ法(ミストCVD成膜法)による成膜ソリューションは、大手企業向けのビジネス展開となることから、事業プランと連携した綿密な知財戦略を構築している。
- 知的財産部長に加え、弁理士試験合格者、米国出願経験豊富な実務経験者の3名体制で、知財戦略の設計から出願・登録に至るまでの全ての業務を内製化して、国内特許事務所を活用せずに実施している。また、自社技術に精通した者が明細書を作成するため、良質な出願書類を効率的に作成できている。基本特許を含め積極的に権利化しており、株式公開前に国内外の特許登録件数を100件以上にする予定である。
- パテントマップを作成して事業戦略の検討に利用している。俯瞰図を作成し、他のベンチャー企業や海外企業の動向を注視しつつ対応するとともに、特許情報を分析し、技術的な相乗効果を生むパートナー候補企業を抽出し、異分野連携に活用している。また、海外市場も視野に入れており、欧州、米国、中国、韓国、台湾等への海外出願をも行った上で、営業活動を実施しており、国内外から、サンプル提供の依頼、出資や事業提携の話などが寄せられている。



ミストドライ法



GaOデバイス



展示会でのFLOSFIA展示ブース